

한국특허청-미국특허상표청간 특허심사하이웨이 전면실시에 관한 공동 보도문

한국특허청과 미국특허상표청은 2008년 1월 28일부터 1년간 시범실시한 한-미 특허심사하이웨이 시범실시 프로그램을 2009년 1월 29일부터 전면실시로 전환하기로 합의하였으며, 이 사실을 한국특허청과 미국특허상표청이 공동으로 발표합니다.

특허심사하이웨이는 양 국가에 공통으로 특허가 출원된 경우, 제1청 출원 중 특허가능하다고 판단한 청구항이 있으면, 제2청은 제1청의 심사결과를 활용하여 대응되는 제2청 출원이 조기에 심사를 받을 수 있도록 하는 제도입니다.

한국특허청과 미국특허상표청은 지난 1년간의 시범실시 결과 특허심사하이웨이 프로그램이 출원인의 신속한 특허권 획득과 특허청의 업무 효율 향상에 기여하는 바가 크다는 점을 다시 한번 인식하였습니다.

따라서 양 청은 시범실시 결과를 바탕으로 특허심사하이웨이 시범실시를 전면실시로 전환하기로 합의하였습니다.

한-미 특허심사하이웨이 프로그램의 전면실시는 시범실시 프로그램과 동일한 요건으로 시행될 것이며, 자세한 내용은 각각 한국특허청(<http://www.kipo.go.kr>) 및 미국특허상표청(http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_kipo.html)의 웹사이트에서 확인이 가능합니다.

또한, 한국특허청과 미국특허상표청은 특허심사하이웨이에 대한 출원인의 요구사항과 전면실시 시행 경과를 지속적으로 평가하여, 필요한 경우 양 청간 협의를 통한 신고요건 및 절차의 개정을 고려할 것입니다. 신고요건 및 절차가 개정되는 경우 양 청은 개정내용을 각 특허청의 웹사이트를 통해 공지할 것입니다.

한국특허청 및 미국특허상표청